

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
24 mars 2005 (24.03.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 2005/026838 A2**

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> : **G03F 7/00**

(21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/FR2004/050433

(22) Date de dépôt international :  
15 septembre 2004 (15.09.2004)

(25) Langue de dépôt :  
français

(26) Langue de publication :  
français

(30) Données relatives à la priorité :  
03 50561 17 septembre 2003 (17.09.2003) FR

(71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*) : COM-  
MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR];  
31-33 rue de la Fédération, F-75752 PARIS 15ème (FR).

(72) Inventeur; et  
(75) Inventeur/Déposant (*pour US seulement*) : **GUIBERT,**  
Jean-Charles [FR/FR]; 4, Beau Rivoire, F-38960 SAINT  
ETIENNE DE CROSSEY (FR).

(74) Mandataire : **POULIN, Gérard; BREVATOME, 3, rue**  
du Docteur Lancereaux, F-75008 PARIS (FR).

(81) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible*) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

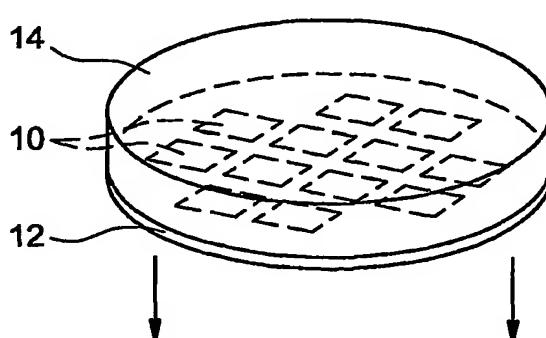
Publiée :

— *sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport*

*En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.*

(54) Title: MICROLITHOGRAPHY METHOD USING A MASK WITH CURVED SURFACE

(54) Titre : PROCEDE DE MICRO-LITHOGRAPHIE UTILISANT UN MASQUE A SURFACE COURBE



(57) Abstract: The invention concerns a method for preparing a lithography mask, comprising: a step which consists in providing patterns (10) on a planar substrate (12), a step which consists in transferring the patterns onto a support (16) having a non-null curvature in at least one point of its surface.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de préparation d'un masque de lithographie, comportant : une étape de réalisation de motifs (10) sur un substrat plan (12), une étape de report des motifs sur un support (16) ayant une courbure non nulle en au moins un point de sa surface.

WO 2005/026838 A2